

低炭素関連装置 運用細目

装置名	ラジカルモニター付きダイヤモンド成膜装置
設置場所	早稲田大学 理工学部63号館7階709号室
装置管理者	川原田 洋
取扱責任者	川原田 洋

1 パワーユーザの必要要件、権限範囲

- (1) パワーユーザとは、装置の停止、立ち上げ、一般管理（記録、備品準備など）等について取扱い責任者と同等の技量を持ち、かつ、精密装置の操作に適した感性、几帳面さを持つ者である。
- (2) パワーユーザは、各研究室で1名決める。パワーユーザを決めることができない研究室は、他研究室のパワーユーザが兼務しても可（事前に依頼にこと）。
- (3) パワーユーザは、取扱責任者の講習を受け、合格した者とする。また、定期的な講習を通して、技量の維持向上を図ることとする。
- (4) パワーユーザは、一般利用者の補助・講習を行う。特に、メインチャンバの 대기開放および停電などにおける装置の立ち下げ、キャリアガスやリークガスとして利用している窒素ボンベの交換および利用しているガスボンベの交換に関しては、パワーユーザのみが行い、一般利用者は操作できない。

2 一般利用者の定義について

- (1) 一般利用者はパワーユーザから講習をうけ、合格したのち取扱い責任者が承認した者とし、本定義に従う一般利用者のみ当該装置を利用可とする。
- (2) 学外からの利用依頼に関しては、関連研究室で、上記に則り対応する。

3 利用制限、禁止行為について

- (1) ラジカルモニター付きダイヤモンド成膜装置はロードロックシステムを採用しており、基本的にメインチャンバは真空状態のままで保たれており、 대기開放する必要はない。したがって、基板紛失などの際のメインチャンバの 대기開放は、パワーユーザのみに限る。また、指定されたガス以外のものの利用や、異常な環境下での実験（業者から指定された圧力下および温度制御下）は行うことができない。